

심포지움 안내

International Symposium Polymer Materials for Advanced Technology

본 학회에서는 선진연구개발 동향에 관한 産學協同과 情報交換을 목적으로 “先進技術을 위한 高分子材料”의 국제 심포지움을 다음과 같이 개최할 예정입니다. 본 심포지움에는 최근 尖端素材로서 주목을 받고 있는, 高分子薄膜, 光學 및 特性高分子, 高分子 블렌드 및 高性能高分子 분야의 연구개발에 오랫동안 종사하신 미국, 일본 및 국내의 저명한 분들이 참석할 계획이오니, 會員여러분의 많은 참여 바랍니다.

· 日時 : 1991년 3월 11일(월)~12(화)

· 場所 : Sheraton Walker Hill Hotel

· 主催 : 한국고분자학회, 한국IBM

· 招請演師

미국(10명) : Prof. Richard S. Stein (Univ. of Massachusetts)

Prof. Jean M. J. Frecht (Univ. of Cornell)

Prof. 유혁 (Univ. of Wisconsin)

Prof. 노영준 (Univ. of Cincinnati)

Dr. C. Grant Wilson (IBM 연구소)

Dr. Do Y. Yoon (IBM 연구소)

Dr. Thomas C. Clarke (IBM 연구소)

Dr. William Hinsberg (IBM 연구소)

Dr. James R. Lyster (IBM 연구소)

Dr. Robert J. Twieg (IBM 연구소)

일본(3명) : Prof. A. Abe (동경공대)

Prof. T. Kajiyama (구주대)

Prof. S. Miyata (동경농공대)

한국(6명) : Dr. 김정엽 (KIST)

Prof. 진정일 (고려대)

Dr. 여종기 (럭키 중앙연구소)

Prof. 김성철 (KAIST)

Dr. 안광덕 (KIST)

Prof. 조원호 (서울대)

* 참가비 및 상세한 일정은 추후 통보할 예정이며, 기타 문의사항은 고분자학회로 연락바람.